

## 知的財産権関連情報 Intellectual Property Information

(特許法等の一部改正 令和2年(2020年)4月1日に施行されます。)

### 【主な改正点】

#### (1)「査証制度」の導入 <特許>

特許権の侵害の可能性がある場合に、裁判所の選定した技術的専門家が立ち入り調査を行う制度です。特許権の侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出します。

[査証制度の利用が想定されるケース(例)]

- ・ 製造方法の特許権の侵害。  
→侵害製品を分解しても権利侵害かどうかの判断が難しいケース。
- ・ プログラムの特許権の侵害。  
→そもそも侵害製品を物理的に入手できないケース。

一方で、制度の濫用を防ぐために

- (a)査証を行うための要件は厳格に規定されています。
- (b)専門家には秘密保護のための規定が設けられています。

#### (2)損害賠償額算定方法の見直し <特許・実案・意匠・商標>

民事上の損害賠償請求において、特許権者への保護を手厚くするため、損害額の算定基準を見直しました。

##### (i)損害額の算定について

<これまで>

侵害が認められても、特許権者の生産・販売能力を超えた分の、侵害者の生産・販売数量については、損害額の算定に際して考慮されませんでした。

<改正後>

裁判所は、特許権者の生産・販売能力を超えた分についても、侵害者へのライセンス料相当額を考慮して、全体の損害額を算定できるようになります。

##### (ii)ライセンス料相当額の増額 <特許>

<これまで>

(通常の)ライセンス料相当額を、特許権者の最低限受けた損害として、損害額

の算定を行なっていました。

<改正後>

「特許権侵害を前提としたとき、特許権者は侵害者にどれだけのライセンス料を求めめるか」を裁判所は考慮して、損害額の算定を行えるようになります。

→特許権者が生産・販売能力の低い中小企業やベンチャー企業であっても、侵害者から十分な賠償を得られる可能性が高まります。

### (3) 保護対象の拡充 <意匠>

<これまで>

- ①意匠法で保護の対象となる意匠(≒デザイン)は物品上に表れていなければなりませんでした。
- ②不動産はすべて保護の対象外でした。

<改正後>

以下の意匠も保護対象となりました。

- ①物品に記録・表示されていない画像  
ネットワーク上にのみデータが存在する、物品の機能・操作のために使われる画像(これまでは物品との一体性が要件とされていました)や、車載画像処理システムにより道路に投影する画像などが保護対象となります。
- ②建築物の外観・内装のデザイン  
外観や内装の特徴的で統一感があるデザインならば、不動産であっても保護対象となります。

### (4) 関連意匠制度の見直し <意匠>

<これまで>

「関連意匠」制度は、比較的短期間に考案されたデザイン・コンセプトを保護するための制度でした。

- ①本意匠(自ら出願した意匠又は自らが権利を持つ意匠)に類似する意匠(=関連意匠)に限り、
- ②本意匠が意匠登録されたことの公表されるまで(出願から8ヶ月程度)であれば、  
制度の利用が認められていました。

<改正後>

一貫したデザイン・コンセプトに基づき、比較的長期間にわたり開発され続ける（小幅なバージョンアップを繰り返す）デザインを保護できる制度となります。

- ①関連意匠にのみ類似する意匠も、その関連意匠を本意匠とみなして、
- ②基礎意匠（最初の本意匠）の出願日から10年以内であれば、  
制度の利用が認められるようになります。

#### (5) 存続期間の変更 <意匠>

<これまで>

意匠出願の登録日から20年でした。

<改正後>

意匠出願の出願日から25年になり、実質的に権利期間の延長が見込めます。

\* 関連意匠の権利の存続期間は基礎意匠の出願日から25年間で満了します。

#### (6) 出願手続の簡素化 <意匠>

<これまで>

意匠法では、意匠権の範囲を明確にするために

- ①一意匠ごとに出願しなければならず、
- ②願書に「物品の区分」を記載しなければなりませんでした。

<改正後>

手続を簡素化し、柔軟な記載を可能にするために

- ①複数の意匠でも一出願でまとめられるようになり、
- ②願書から「物品の区分」の記載を廃止します。

\* 施行日は令和1年（2019年）5月17日から2年以内となりますが、令和2年（2020年）2月20日時点では未定です。

#### (7) 間接侵害規定の拡充 <意匠>

<これまで>

放置すれば意匠権の直接侵害につながる可能性が極めて高い第三者の行為に限り、間接侵害が認められていました。

<改正後>

第三者が、自らの行為が意匠権の直接侵害につながることを知っている場合に、

間接侵害が認められるようになります(主観的要件の導入)。

たとえば、複数のパーツから成る製品をパーツごとに分解して輸入し、その後、日本国内で組み立てて販売しようとするケースなどに、間接侵害の規定が及びます。

## (8)直近の主だった改正点(令和1年(2019年)5月1日に施行済) <意匠>

### ①図面についての方式的要件の緩和

#### (1)「一組の図面」について

記載する図面の数にかかわらず、意匠の創作の具体的な内容を特定できるならば、要件を満たすものとなりました。

#### (2)「意匠登録を受けようとする物品以外の記載」について

意匠登録を受けようとする物品と、それ以外とが明確に描き分けられている場合又は、その旨を願書の【意匠の説明】の欄に記載していれば、意匠登録を受けようとする物品以外のものを図面に記載することが認められるようになりました。

#### (3)中間省略の記載方法について

意匠の一部を省略して図示する場合に、中間を省略する図法であることが明らかであれば、認められるようになりました。

### ②願書の部分意匠の欄に係る規定の見直し

意匠登録出願の願書及び意匠原簿に部分意匠の欄を設けなければならないとする規定が廃止されました。

一部を除き令和2年(2020年)4月1日に施行

参考 Web サイト:

[経済産業省]

<https://www.meti.go.jp/press/2018/03/20190301004/20190301004.html>

[特許庁]

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/syoreikaisei/isho/49\\_isyou\\_syousei.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/syoreikaisei/isho/49_isyou_syousei.html)